

多層グラフェンを用いた超高透過率・高耐久 EUV ペリクルの開発（株式会社エアメンブレン）



○事業内容

本提案は、半導体露光装置の中核であるEUVペリクルに超薄多層グラフェン膜を適用することで、装置消費電力を1~3%削減し、歩留まり低下による廃棄ウエハを抑制します。これにより、データセンターやAIアクセラレータなど社会のあらゆるデジタルインフラでの電力需要を低減し、GX（グリーントランスフォーメーション）を加速します。

所在地	創設年	創設者名
茨城県つくば市	2017年	古賀 義紀 長谷川 雅考

事業領域・分野	助成事業年度	交付決定額	海外技術実証
素材・材料	STS 2025~2027年度	293百万円	—

パートナーVC	直近の資金調達ラウンド	企業価値
—	プレシリーズA	1,000百万円

会社連絡先：

tel : 029-869-6551

fax : 029-869-6552

ホームページリンク <https://www.airmembrane.co.jp>

2025年11月現在